

廃棄物発生量・最終埋立処分量の削減

廃棄物の発生量と最終埋立処分量を削減するためにゼロエミッションを進めています。

2005年度の目標(国内)

- ・2005年度までに国内拠点でゼロエミッションを達成
- ・2005年度までに廃棄物発生量を生産高原単位で30%削減(2000年度比)

2005年度の実績(国内)

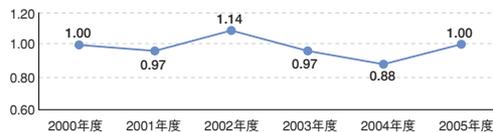
ゼロエミッションの達成

新たにカシオマイクロニクス(青梅)とカシオソフトの2拠点/事業所がゼロエミッションを達成しました。これで、デバイス事業に関係する全事業所で達成したことになり、全体では目標対象である16拠点のうち、13拠点でゼロエミッションを達成しました。

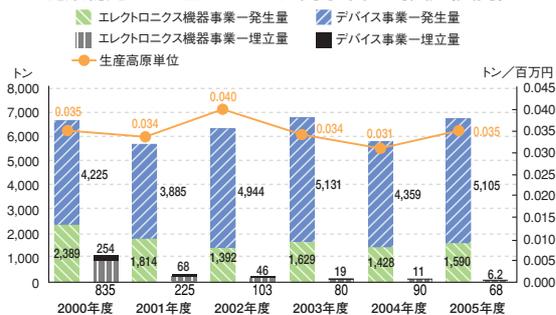
廃棄物発生量の削減

生産高原単位は2000年度と同等になりました。

2000年度を1とした場合に対して各年の生産高原単位の推移



廃棄物発生量・埋立量と生産高原単位の推移(国内)



生産高原単位の分子である廃棄物発生量は2004年度に比べて908トン増加しています。特に、デバイス事業での廃棄物発生量が746トンと大幅に増加しています。これは事業活動の増大に伴い、廃棄物の発生量が増加したためです。

これに対して、分母となる生産金額はTFT液晶の単価下落などで小さくなっています。

また、最終埋立処分量は、27トン削減されました。

削減された理由として、デバイス事業における積極的な再資源化への取り組みがあります。高知カシオではエコセメント化、甲府カシオでは再資源化処理委託先の選定などです。

さらに、廃棄物発生量を国内と海外に分けてみると、2005年度8,527トンのうち国内6,695トン(78.5%)、海外1,832トン(21.5%)

です。

最終埋立処分量は2005年度625トンのうち国内74トン(11.8%)海外551トン(88.2%)です。

廃棄物発生量と最終埋立処分量の推移(国内と海外の合計)



今後の目標

国内拠点

廃棄物発生量の実質生産高原単位を2008年度までに40%削減(2000年度比)

海外拠点

廃棄物発生量の生産高原単位を2008年までに10%削減(2004年度比)に対しては、グラフに示す目標で削減に取り組みます。

[国内拠点]

基準年(2000年度)を1とした場合に対して目標年度(2008年度)までの実質生産高原単位の目標値



[海外拠点]

基準年(2004年度)を1とした場合に対して目標年度(2008年度)までの生産高原単位の目標値

